

09; 10; 11

© 1991

О ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРОНОВ
ГЕКСАБОРИДЛАНТАНОВОГО ЭМИТТЕРА
ДИОДНОГО УСТРОЙСТВА С МИКРОЗАЗОРОМ

В.К. С о л о н о в и ч

Обычно исследования функции распределения эмиттерных термоэлектронов по энергиям $f(E)$ проводятся по методу Шелтона [1] или энергоанализатором типа гиперболоидного зеркала [2], в которых, как правило, используются внешние электрическое и магнитное поля. В большинстве случаев $f(E)$ имеет максвелловский вид. Вместе с тем, в ряде работ [3–5] показано, что функция $f(E)$ либо искажена [3, 4], либо сдвинута со своим максимумом в относительно высокоэнергетическую область [5], либо имеет более сложный немаксвелловский вид [2].

Сложность исследования функции распределения термоэлектронов по энергиям $f(E)$ заключается в том, что их энергия E невысока и лежит в пределах 0–2 эВ, для анализа которой требуется выполнение предварительных условий. Во–первых, с целью снижения степени пятнистости эмиттера – использование в качестве электродов монокристаллов, а во–вторых, – устранение отрицательного влияния объемного заряда электронов без использования внешнего электрического поля. Последняя задача является наиболее сложной при исследовании термоэмиссии [1], но разрешимой [6, 7].

Ранее в работе [8] были обнаружены аномалии вольт–амперных характеристик (ВАХ) плоскопараллельного диода с монокристаллическими электродами из переходных металлов в ускоряющей области напряжений $U \sim 0$ –1 В и соответственно искажение максвелловской функции распределения эмиттированных электронов, определяемой электростатическим энергоанализатором [2]. Механизм обнаруженных аномалий ВАХ и $f(E)$ авторами этих работ объясняется рекомбинацией френкелелевских пар выше некоторых критических температур.

В работах [6, 7] также были обнаружены аномалии ВАХ, но в запирающей области напряжений $U \sim -0.1$ –0 В, диодного устройства с электродами из W (Ш), $\text{La}_2\text{B}_6(100)$ и шириной межэлектродного зазора $d_{\text{ЭК}} = 10$ –100 мкм, когда влиянием объемного заряда термоэлектронов можно пренебречь. Последнее и подтверждается хорошим совпадением измеренных значений работы выхода эмиттера этого диода методом Шоттки и нагрузочных кривых [6].

В настоящей работе приводятся данные о функции распределения термоэлектронов по энергиям $f(E)$ с поверхности монокристалла $\text{La}_2\text{B}_6(100)$ вакуумного плоскопараллельного диодного устройства

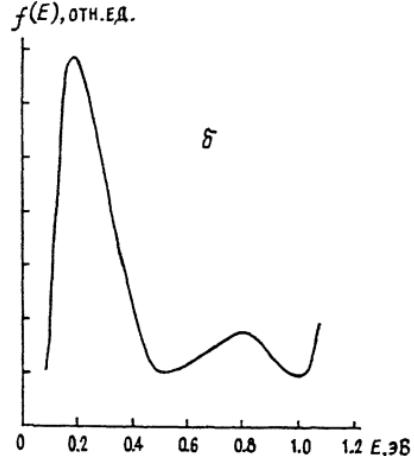
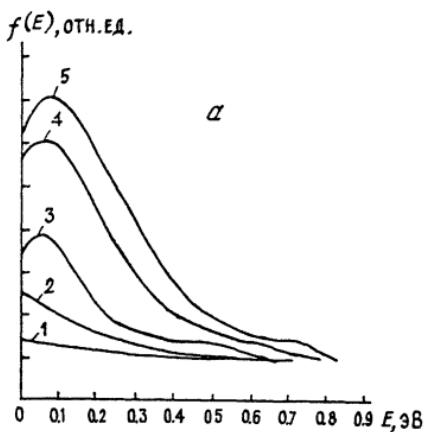


Рис. 1. Зависимость функции распределения $f(E)$ термоэлектронов по энергиям от температуры эмиттера $\text{LaB}_6(100)$ вакуумного диодного устройства с микрозазором при $d_{\text{ЭК}}=10 \text{ мкм}$, $\Delta T_{\text{ЭК}} = -300 \text{ К}$. а: $T_{\text{э}}$, К: 1 - 1473, 2 - 1523, 3 - 1573, 4 - 1623, 5 - 1673. б: $T_{\text{э}}=1873 \text{ К}$.

с микрозазором. Функция $f(E)$ определялась дифференцированием ВАХ такого диода на компьютере. Условия снятия ВАХ диодного устройства и характеристики исследуемых электродов подробно описаны в работах [6, 7].

На рис. 1, а, б показаны функции распределения термоэлектронов $f(E)$ в зависимости от температуры $T_{\text{э}}$ гексаборидлантанового эмиттера. Как видно из этого рисунка, $f(E)$ имеет максвелловский вид, однако при $T_{\text{э}}=1573 \text{ К}$ в ее хвосте появляется второй (неравновесный) пик. Этот пик отчетливо заметен при температуре эмиттера $T_{\text{э}}=1873 \text{ К}$ (рис. 1, б), где его максимум лежит $\sim 0.8 \text{ эВ}$. При $T_{\text{э}} \geq 1573 \text{ К}$ (рис. 1, а, б) с ростом температуры эмиттера первый (равновесный) и второй (неравновесный) пики $f(E)$ смешаются в относительно более высокоэнергетическую область. Отсутствие второго пика при $T_{\text{э}} < 1573 \text{ К}$ свидетельствует только о максвелловском распределении термоэлектронов. Это подтверждается и производной $df(E)/dE$ от функции $f(E)$ (рис. 2, а, б), выражаяющая, по существу, спектр термоэлектронов. Выше $T_{\text{э}}=1523 \text{ К}$ наблюдается разделение $df(E)/dE$ на два максимума. Интенсивность первого максимума заметно возрастает и он смещается от 0.18 до 0.40 эВ при $T_{\text{э}}=1573-1873 \text{ К}$. Интенсивность же второго максимума практически не изменяется, но он также смещается в более высокоэнергетическую область от 0.65 до 0.90 эВ в этом же интервале температур эмиттера.

Появление неравновесного пика на функции распределения $f(E)$ рис. 1, а, б, при критической температуре $T_{\text{э}}=1573 \text{ К}$, с одной стороны, по-видимому, связывается с обогащением поверхности эмиттера $\text{LaB}_6(100)$ лантаном вследствие диффузии его из объема,

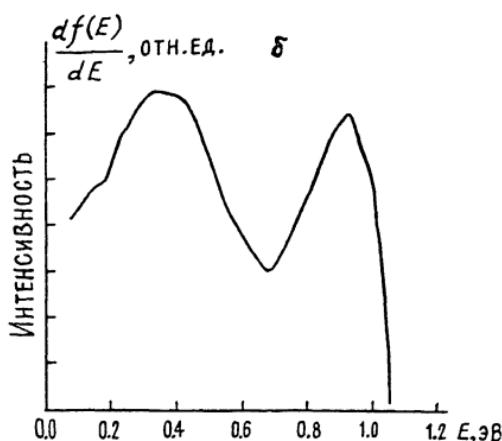
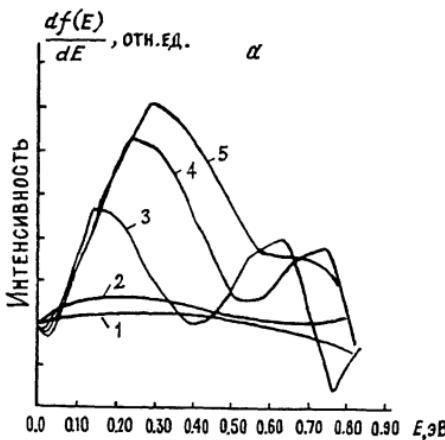


Рис. 2. Спектр термоэлектронов $dF(E)/dE$ эмиттера $LaB_6(100)$ диодного устройства при $d_{ЭК}=10$ мкм и межэлектродной разности температур $\Delta T_{ЭК}=300$ К. а: T_e , К: 1 - 1473, 2 - 1523, 3 - 1573, 4 - 1623, 5 - 1673, б: $T_e=1873$ К.

при этом получается пленочная система, которая и формирует поток термоэлектронов с такой $f(E)$. Это подтверждается и нарушением соотношения B/La в приповерхностной области эмиттера, а также изломом на температурной зависимости работы выхода $\varphi_0(T_e)$ при $T_e \geq 1573$ К [6].

С другой стороны, при исследовании термоэмиссии в диодных устройствах с микрозазором нельзя исключить влияние на $f(E)$ пондеромоторного эффекта. В частности, в работах [9-11] показано, что при $d_{ЭК}=1-10$ мкм пондеромоторные силы, возникающие вследствие электростатического и электромагнитных взаимодействий между электродами, достигают величины $F \sim 0.3-0.05$ дин/см² или что эквивалентно возникновению собственного электрического поля $E_0 \sim 10^4-10^3$ В/см, достаточного для устранения отрицательного влияния объемного заряда термоэлектронов и стимулирования выхода электронов с занятых поверхностных состояний эмиттера на незанятые поверхностные состояния коллектора. Таким образом, это поле содействует появлению неравновесного пика на $f(E)$ (рис. 1, а, б).

Здесь уместно также отметить, что при увеличении ширины межэлектродного зазора $d_{ЭК}$ интенсивность неравновесного пика $f(E)$ уменьшается и, например, при $d_{ЭК}=200$ мкм и $T_e=1573$ К практически исчезает. Подобный эффект наблюдался и для диодного устройства с электродами из $LaB_6(110)$, но при несколько больших зазорах.

Таким образом, при отсутствии отрицательного влияния объемного заряда термоэлектронов в вакуумном диодном устройстве, которого можно достичь сокращением ширины межэлектродного зазора, например, до 10 мкм, представляется возможность определять

функцию распределения эмиттированных электронов $f(E)$, спектр термоэлектронов $df(E)/dE$, а также их особенности. Полученные данные $f(E)$ и $df(E)/dE$ для $\Delta\alpha B_6(100)$ вызывают как научный, так и практический интерес для исследования состояния поверхности электродных материалов при высоких температурах, а использование компьютера позволит в дальнейшем создать метод для изучения тонкой структуры спектров термоэлектронов.

Список литературы

- [1] Д обрецов Л.Н., Гомоюнова М.В. Эмиссионная электроника. М.: Наука. 1966. 564 с.
- [2] М аштакова В.А., Пирогова Ю.А., К овалев С.В., Голосковова Л.Ю., Бабаев В.Г. // Изв. вузов. Радиофизика. 1985. Т. 28. № 3. С. 372-378.
- [3] M org e n S., R e i f e n b e r g e r R. // Surf. Sci. 1987. V. 186. P. 232-246.
- [4] Можайс Б.Я., Н аумов В.Н. // ЖТФ. 1978. Т. 48, В. 10. С. 2120-2126.
- [5] L e w o w s k i T., M a z u z P. // Acta Univ. Wratislaviensis. 1981. V. 607. P. 69-73.
- [6] B u l y g a A.V., S o l o n o v i c h V.K. // Surf. Sci. 1989. V. 223. P. 578; // Высокочистые вещества. 1990. № 3. С. 74-79.
- [7] Б улыга А.В., С олонович В.К. // Электронная техника. Сер. 4. 1990. В. 2(129). С. 3-6.
- [8] М аштакова В.А., Ш ишкин Б.Б. // Письма в ЖЭТФ. 1979. Т. 30. В. 2. С. 99-102.
- [9] S o l o n o v i c h V.K., K u k h a r e n k o L.V., F i n o c c h i F., B e r t o n i C.M., O s s i c i n i S. // Vuoto, Sci. e techn. 1990. 20. N 1. P. 85-87.
- [10] С олонович В.К., Кухаренко Л.В. // ВАНТ. Сер. Ядерно-физические исследования. (Теория и эксперимент). 1990. В. 2(10). С. 47-49.
- [11] С олонович В.К. // Тез. докл. XXI Всесоюз. конф. по эмиссионной электронике. Л., 1990. Ч. 1. С. 191.

Институт физики
твердого тела
и полупроводников
АН БССР

Поступило в Редакцию
17 июня 1991 г.